GGA+U 法による Si_{1-x}Sn_x 材料物性の精密予測

A precise prediction of material properties of Si_{1-x}Sn_x by using the GGA+U method

¹名大院工, ²学振特別研究員(PD), ³学振特別研究員(DC), ⁴名大エコトピア [○]長江祐樹 ¹, 黒澤昌志 ^{1,2}, 加藤元太 ¹, 柴山茂久 ^{1,3}, 中塚理 ¹, 財満鎭明 ^{1,4} ¹ Graduate School of Engineering, Nagoya University, ² JSPS Research Fellow (PD), ³ JSPS Research Fellow (DC), ⁴ EcoTopia Science Institute, Nagoya University [○]Y. Nagae ¹, M. Kurosawa ^{1,2}, M. Kato ¹, S. Shibayama ^{1,3}, O. Nakatsuka ¹, and S. Zaima ^{1,4}

E-mail: ynagae@alice.xtal.nagoya-u.ac.jp, kurosawa@alice.xtal.nagoya-u.ac.jp

[はじめに] 光通信帯域(1.5 μ m)に合致する光学材料として $Si_{1-x}Sn_x$ 直接遷移型半導体の創生に大きな期待が寄せられている。最近我々は、Sn 固溶限(0.1%)をはるかに超える $Si_{1-x}Sn_x$ (Sn 組成 x>20%)の多結晶および単結晶成長に成功し、その光学吸収特性を実験的に明らかにした[1]。デバイス設計に向けて理論計算の助けが必須である。経験的擬ポテンシャル法[2]や密度汎関数法[3]による $Si_{1-x}Sn_x$ バンド構造計算が 10 年近く前になされたものの、高 Sn 組成化の実現に懐疑的だったこともあり、 $Si_{1-x}Sn_x$ の物性には不明な点が多い。実験・理論の両輪による $Si_{1-x}Sn_x$ 材料物性の解明を目指した研究が重要な時期に来ている。本研究では、精密なバンド構造の予測が可能な第一原理計算シミュレーション手法として、generalized gradient approximation + U value (GGA+U)法を導入し、 $Si_{1-x}Sn_x$ の各種物性値に Sn 組成が与える影響について、系統的な理論予測を試みた。

[計算手法とモデル] 全電子を考慮した第一原理計算 (projector augmented wave method) を行い、本計算に必要な交換相関エネルギーには GGA (PBE 関数) [5]を採用した。精密な計算を行うために、Si および Sn の S 電子に+U の Hubbard 補正項を導入し、Si の間接バンドギャップおよび α -Sn の直接バンドギャップをそれぞれ 1.161 eV および 0 eV に補正した。本研究では、ユニットセル内に 8 つの Si または Sn 原子を配置したダイヤモンド構造 (Fig. 1) に対して計算を行った。

[結果および議論] 各 Sn 組成の $Si_{1-x}Sn_x$ に対して計算された格子定数を Fig. 2 にまとめた。図中には、実際に我々が作製した多結晶 $Si_{1-x}Sn_x$ について、格子置換位置 Sn 組成および格子定数をそれぞれ顕微ラマン分光法および X 線回折法により評価した結果も示した。計算結果が実験値より大きく (例えば、Si では 1.5%、 α -Sn では 2.6%) 見積もられるのは、GGA 法を用いると格子定数を過大評価する傾向にあるため [6]と考えている。よって、以降では格子定数のボーイングについて議論する。 $a_{SiSn}=a_{Si}(1-x)+a_{Sn}x-bx(1-x)$ のフィッティング式を用いて、計算および実験値に対するボーイングパラメータ b を求めた結果、それぞれ、 $b_{Calc.}=-0.47$ Å, $b_{exp.}=-0.66$ Å が得られた。計算結果には多少ばらつきがあるものの、両者のオーダーは一致した。これらの値は、 $Si_{1-x}Ge_x$ や $Ge_{1-x}Sn_x$ のボーイングパラメータ ($Si_{1-x}Ge_x$: -0.026 Å[7]、 $Se_{1-x}Sn_x$: +0.166 Å[8]) の絶対値に比べ、約 3~18 倍大きい。これは、Si と Sn 間に存在する大きな原子半径差に起因するものと推測され、妥当な結果と判断できる。講演当日は、バンド構造計算等の結果もあわせて報告したい。

[参考文献] [1] M. Kurosawa *et al.*, *submitted*. [2] J. L. Corkill *et al.*, Phys. Rev. B **47**, 10304 (1992). [3] J. Tolle *et al.*, Appl. Phys. Lett. **89**, 231924 (2006). [3] M. J. Han *et al.*, Phys. Rev. B **73**, 045110 (2006). [4] P. E. Blöchl, Phys. Rev. B **50**, 17953 (1994). [5] J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. **77**, 3865 (1996); **78**, 1396 (1997). [6] S. Q. Wang *et al.*, J. Phys.: Condens. Matter **15**, L197 (2003). [7] J. P. Dismukes *et al.*, J. Appl. Phys. **35**, 2899 (1964). [8] A. V. G. Chizmeshya *et al.*, Chem. Mater. **15**, 2511 (2003).

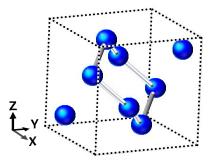


Fig. 1 Schematic illustration of the unit cell (diamond structure) using in this calculation.

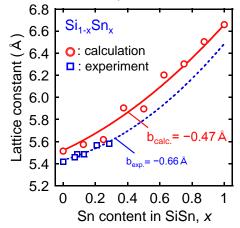


Fig. 2 The lattice constant of $Si_{1-x}Sn_x$ as a function of the Sn content. The experimental results for the polycrystalline $Si_{1-x}Sn_x$ layers (square symbol) and the calculated values (circle symbol) are summarized.